### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-300964

(43) Date of publication of application: 23.10.1992

(51)Int.Cl.

C08L 83/06 C08K 3/00 C08K 5/3477 C08K 5/54 C08K 5/57

(21)Application number: 03-350500

(71)Applicant:

GENERAL ELECTRIC CO <GE>

(22) Date of filing:

11.12.1991

(72)Inventor:

**LUCAS GARY MORGAN** 

(30)Priority

Priority number : 90 628312

Priority date : 17.12.1990

Priority country: US

#### (54) ROOM TEMPERATURE VULCANIZABLE SILICONE COMPOSITION HAVING IMPROVED LOW MODULUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a room temperature vulcanizable silicone composition having an improved low modulus that has improved adhesion without using a primer and storage stability and contains a decreased amount of a scavenger.

CONSTITUTION: This composition comprises (A) 100 pts. polyalkoxyterminated polydiorganosiloxane in which the viscosity (25° C) is 100 to 1000,000 P the terminal of the chain of each polymer has at least two silicon atoms and alkoxy groups as terminal substituents, and the organo group is a 1–26C monovalent hydrocarbon, (B) 1 to 40 pts. monoalkoxyterminated polydiorganosiloxane polymer wherein only one alkoxy group is present on each terminal silicon atom in the polymer chain, the viscosity at 25° C is 5 to 95 P and the organo group is a 2–15C monovalent hydrocarbon, (C) a diorganotin bis-p-diketonate condensation catalyst represented by formula I (R5 represents 1–15C monovalent hydrocarbon or the like and R6 to R8 each represent H or the like), (D) 0.1 to 1 pt. scavenger compound for hydroxyl functional groups, etc.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号

# 特開平4-300964

(43)公開日 平成4年(1992)10月23日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所	
C O 8 L 83	/06	LRZ LRX LRW LRU	8319 — 4 J 7167 — 4 J					
C08K 3	/00							
5,	/3477		7167 — 4 J					
5,	/54		7167 -4 J					
5,	/57	LRS	7167 -4 J	•				
				\$	<b>審查請求</b>	未請求	請求項の数11(全 13 頁)	
(21)出職番号	特	■平3-350500		(71)出願人	3900415	42		
					ゼネラル	レ・エレク	フトリツク・カンパニイ	
(22)出職日	本	平成3年(1991)12月11日			GENE	ERAL	ELECTRIC CO	
					MPAN	1 Y		
(31)優先権主張	<b>番号</b> 6	28.312			アメリカ	<b>台衆国</b> 、	ニユーヨーク州、スケネ	
(32)優先日	19	90年12月17日			クタディ	1、リパー	-ロード、1番	
(33)優先權主張	国 米	米国 (US)		(72)発明者	ゲイリー	ー・モルカ	<b>ガン・ルーカス</b>	
					アメリカ	<b>古衆国、</b>	ニユーヨーク州、スコテ	
					イア、も	マント・ブ	アンソニー・レーン、21番	
				(74)代理人	井理士	生沼 6	5_	
•				(74)代理人	イア、も	マント・ブ	アンソニー・レーン、21番	

(54) 【発明の名称】 改善された低モジュラス性をもつ室温硬化性シリコーン組成物

#### (57)【要約】 (修正有)

【構成】ポリアルコキシ末端ジオルガノポリシロキサン100部、低粘度モノアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサンである低モジュラス改善添加剤1~40部、ジオルガノ鍋ピスーβージケトネート結合触媒有効量及びヒドロキシ基用の珪素ー窒素スカペンジャー化合物0.1~1.0部を含有してなる一液型の室温硬化性オルガノポリシロキサン組成物。該組成物はさらに充填剤、ポリアルコキシシラン架鍋剤、接着促進用ポリアルコキシシラン及びシアノ官能性ポリアルコキシシラン及びシアノ官能性ポリアルコキシラン加工助剤を含有してよい。

【効果】プライマー不使用で改善された接着性をもち、 貯蔵安定性で、低減された量のスカペンジャーを含み、 低モジュラス性能を改善する。

#### 【特許請求の範囲】

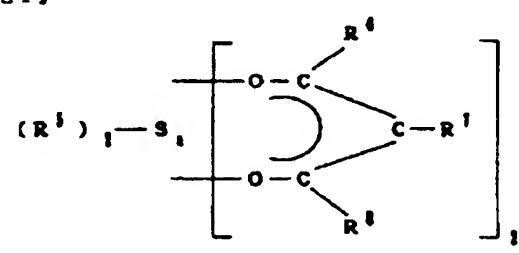
#### 【請求項1】 つぎの成分:

(A) 25℃で約100ないし約1,000,000センチポイズの粘度をもち、各重合体顕末端の珪素原子が少なくとも2個のアルコキシ基を末端置換基として有しかつオルガノ基がCi-isの一個の炭化水素基であるポリアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン100部;

(B) 重合体領中の各末端珪素原子上に1個のみのアルコキシ基を有し、25℃で約5ないし約95センチポイズの粘度をもちかつオルガノ基がC1-15の一個の炭化水 10素基であるモノアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン重合体約1ないし約40部;

## (C) 一般式:

#### 【化1】



(式中、R<sup>5</sup> はC<sub>1-1</sub>の一価の炭化水素基又は置換された一価の炭化水素基であり、そしてR<sup>6</sup> , R<sup>7</sup> 及びR<sup>6</sup> は水素、R<sup>6</sup> , O R<sup>6</sup> , - S i (R<sup>5</sup> ) 1 、 - O S i (R<sup>5</sup> ) 3、アリール、アシル及びニトリル基からなる群から選んだ同一でも異なってもよい一価の基である)をもつジオルガノ揚ビスーβージケトネート縮合触媒の有効量;

(D) ヒドロキシル官能基用のスカペンジャー化合物的 0. 1ないし約1. 0部;

# (E) 式:

$$R^{4}$$
; (R<sup>1</sup> O) <sub>1-1</sub> -Sj-Z

(式中、R<sup>3</sup> 及びR<sup>4</sup> はC<sub>1-1</sub> の一個の炭化水素基であ \*

◆り、しは0ないし3であり、そして2はさらにエーテル、エポキシ、イソシアナト、シアノ、イソシアヌレート、アクリルオキシ及びアシルオキシ基からなる群から選んだ官能基によって置換された飽和、不飽和又は芳香族炎化水素基である)をもつポリアルコキシシラン接着促進剤0ないし約2部:及び

(F) ポリアルコキシシラン架橋剤 0 ないし約 1 0 部; を含有してなる改善された低モジュラス性をもち、低減 された量のスカベンジャーを含む貯蔵安定性の一液型室 温硬化性シリコーン組成物。

【請求項 2】 モノアルコキシ末端ポリジオルガノシロ キサンが式:

【化2】

(式中、mは約1ないし約40の範囲である) をもつ請 20 求項1記載の組成物。

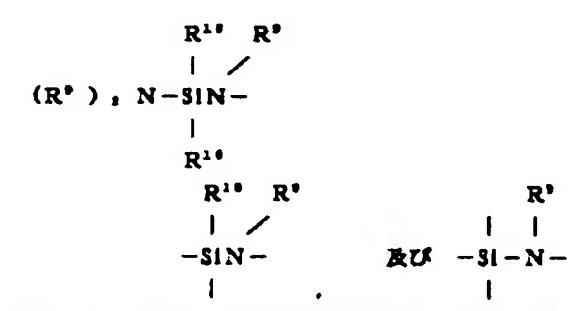
【請求項3】 モノアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサンの粘度が25℃で約10ないし約80センチポイズの範囲である請求項1記載の組成物。

【請求項4】 スカペンジャーが (a) 式:

(Y) 
$$(R^{10})$$
,  $SI-N-SI$   $(R^{10})$ , Y

(式中、YはR<sup>1</sup>°及び(R<sup>9</sup>): N-から選ばれ、R<sup>9</sup> は水素、一価炭化水素基及びフルオルアルキル基からな る群から選んだ一員であり、そしてR<sup>1</sup>°は水素、一価炭 化水素基及びフルオルアルキル基からなる群から選んだ 一員である)をもつ珪素-窒素化合物;及び

#### (b) (1) 式:



(式中、R®及びR™は前記の意義を有する)をもつ単位からなる群から選んだ化学結合構造単位3-100モル%及び(2)式:

(R13) c \$10(1-6/2)

50 (式中、R10は前記の意義を有し、そしてcは0ないし

3の整数である)によって表わされる化学結合構造単位 0-97モル名;を含んでなる珪素-窒素重合体、たメ し族珪素-窒素重合体の珪素原子はSiOSi結合及びSiN R\* Si結合から遺んだ一員によって相互に適結されており、酸素に連結されてシロキシ単位を形成している珪素原子の原子値及び窒素に適結されてシラジル単位を形成している珪素原子の原子値以外の珪素原子の原子値はR\* りょ N基から選んだ一員に連結されており、かつ該珪素-窒素重合体のR\*\* 基及び(R\*) よ N基の合計対珪素原子の比は1.5ないし3の値をもつものとする);からなる群から選んだ珪素-窒素化合物である請求項1記載の組成物。

【請求項5】 ポリアルコキシシラン接着促進剤が一般 式:

## 【化3】

$$(R^{11}0)_{3-3} - S_{1} - R^{15} - N - G$$

(式中、GはR11基、式:

$$R^{11}$$
,

(R<sup>13</sup>O) ... -Si-R<sup>13</sup>-

の基、スチリル基、ピニル基、アリル基、クロルアリル 基及びシクロヘキセニル基から選んだ基であり、R<sup>11</sup>は 30 C<sub>1-1</sub> の一価の炭化水素基又はシアノアルキル基であ り、R<sup>11</sup>はC<sub>1-1</sub> の一価の炭化水素基又はシアノアルキ ル基であり、R<sup>13</sup>はアルキレンアリーレン基、アルキレ ン基、及びシクロアルキレン基及びハロゲン化アルキレ ンアリーレン基、アルキレン基及びシクロアルキレン基 から選んだC<sub>2-12</sub>の二価の炭化水素基でありそしてもは りないし3の範囲である)をもつイソシアナト官能性ポ\*

\*リアルコキシシランである請求項1記載の組成物。 【請求項6】 さらに(H)一般式:

【化41

$$(R^{1} O)_{1-1} - S_{i} - R^{5} C = N$$

(式中、各R<sup>1</sup> 及びR<sup>1</sup> は独立的に1ないし約18個の 炭素原子をもつ一価炭化水素基又は置換された一価炭化 10 水素基であり、R<sup>1</sup> はC<sub>2・12</sub>の二価の炭化水素基であ り、そして t は約0 ないし約3 の範囲の数である) をも つシアノ官能性ポリアルコキシシラン0 ないし2 部を含 有してなる請求項1 記載の組成物。

【請求項7】 さらに(G)充填剤を含有してなる請求項1記載の組成物。

【請求項8】 ポリアルコキシシラン架橋剤を約0.3 ないし約2.0部の範囲の量で存在させる請求項1記載 の組成物。

【請求項9】 さらに(I)25℃で10ないし500 20 0センチポイズの粘度をもち、オルガノ基が一個炭化水 素基であるトリオルガノシリル末端ジオルガノポリシロ キサン約1ないし約50重量部を含有してなる請求項1 記載の組成物。

【請求項10】 さらに(J)(i) モノアルキルシロキシ単位、シロキシ単位又はそれらの混合物25ないし60モル%、(ii) トリアルキルシロキシ単位1ないし6モル%及び(iii) ジアルキルシロキシ単位34ないし74モル%を含有しかつ珪素に結合されたヒドロキシル基約0.1ないし約2重量%を含有する液状シロキサン可塑剤1ないし20重量部を含有してなる請求項1記載の組成物。

【請求項11】 重量で、つぎの成分:

(A) 25℃で約100ないし約1,000,000センチポイズの粘度をもち、一般式:

【化5】

$$(R^{1} O)_{3-4} \longrightarrow Si \longrightarrow \begin{pmatrix} R \\ I \\ OSi \\ R \end{pmatrix} \longrightarrow OSi \longrightarrow (OR^{1})_{3-4}$$

(式中、各R、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> はメチル基であり、nは約50ないし約2,500の範囲の整数であり、そしてaは0又は1である)をもつポリアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン100部;

(B) 25℃で約40ないし約60センチポイズの粘度 をもちかつ式:

【化6】

$$(R^{1} O) \longrightarrow \begin{array}{c} R^{2} \\ \vdots \\ Si \\ R^{2} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} R^{2} \\ \vdots \\ OSi \\ R^{2} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} OR^{1} \\ \vdots \\ R^{2} \end{array}$$

(式中、R,  $R^1$  及び $R^2$  はそれぞれメチル基であり、50 そしてmは約10ないし約20の範囲である)をもつモ

ノアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン約15ない し約25部:

- (C) ジ(n-プチル) 錮ヒス(アセチルアセトネー ト) 約0.2ないし約0.4部:
- (D)へキサメチルジシラザン約0.5ないし約0.7 部:
- (E) 1. 3. 5 トリストリメトキシシリルプロビル イソシアナート約0.3ないし約0.7部:
- (F)メチルトリメトキシシラン約0.5ないし約1. 086:
- (G)ヒュームドシリカ充填剤約5ないし約20億:
- (H) β-シアノエチルトリメトキシシラン約 0.3な いし約0.7部:及び
- (【)({)モノアルキルシロキシ単位、シロキシ単位 又はそれらの混合物25ないし60モル%:(川)トリ アルキルシロキシ単位 1 ないし 6 モル%及び(iii)ジ アルキルシロキシ単位34ないし74モル%を含んでな りかつ珪素に結合されたヒドロキシル基を約0.1ない し約2重量%含有する液状シロキサン可塑剤約1ないし 約20部:を含有してなるプライマー不使用で改善され 20 た接着性をもつ貯蔵安定性で一液型の室温硬化性シリコ ーン組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は低減された量のスカペン ジャーを含む一液型の室温硬化性シリコーン組成物に関 する。特に本発明は低減された量のスカペンジャーを含 む一液型の室温硬化性シリコーン組成物の低モジュラス 性能を改善する添加剤に関するものである。

[0002]

【従来の技術】低モジュラス性改善用添加剤を含有する 一液型、アルコキシー硬化性、室道硬化性(RTV)シ リコーンゴム組成物は当該技術において既知である。た とえば、低モジュラス性改善剤として二官能性アセトア ミドカップリング剤を使用するかゝる組成物は米国特許 第4、323、489号明細書 (Beers ) に記載されて いる。

【0003】本発明は、低減された畳のスカペンジャー を含む一液型RTVシリコーンゴム組成物の低モジュラ ス性は後に詳述する低分子量モノアルコキシ末端ジオル 40 ガノポリシロキサンを鎮組成物中に存在させることによ って改善され得るとの知見に基づくものである。

【0004】一液型RTVシリコーンゴム組成物中にモ ノアルコキシ末端ジオルガノポリシロキサンを使用する ことは当該技術において既知である(たとえば米国特許) 第4、593、085号、問第4、670、532号及 び同第4.755.578号明細書(いずれもLucas ら) 参照)。

【0005】上記Lucas らの特許明細書によれば、モノ

ス性改善剤としてではなく、望ましくない汚染物として 存在する。しかも、Lucas らのRTV組成物中に使用さ れているモノアルコキシ末端ジオルガノポリシロキサン は25℃で100ないし1.000.000センチポイ ズの粘度をもつものである。

6

【0006】本発明は、25℃で約5ないし約95セン チポイズの钻度をもつモノアルコキシ末端ジオルガノポ リシロキサンが、モノアルコキシ末端ポリジオルガノシ ロキサンを用いて製造された一液型RTVシリコーン組 10 成物の低モジュラス性を改善するとの知見に基づくもの である。

[0007]

【発明の概要】本発明は、つぎの成分:

- (A) 25℃で約100ないし約1,000,000セ ンチポイズの粘度をもち、各重合体鎖末端の珪素原子が 少なくとも2個のアルコキシ基を末端置換基として育し かつオルガノ基がCュ-ュュの一個の炭化水素基であるポリ アルコキシ末蝿ポリジオルガノシロキサン100部:
- (B) 重合体鎖中の各末端珪素原子上に1個のみのアル コキシ基を有し、25℃で約5ないし約95センチポイ ズの粘度をもちかつオルガノ基がCュ-ュ₃の一価の炭化水 素基であるモノアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサ ン重合体約1ないし約40部:

(C) 一般式:

[0008]

【化7】

30

$$(R^{1})_{1}-S_{1}$$

$$\begin{bmatrix}
0-C\\R^{1}\end{bmatrix}$$

(式中、R<sup>5</sup> はC<sub>1-1</sub>4の一価の炭化水素基又は置換され た一価の炭化水素基であり、そしてR<sup>4</sup>、R<sup>7</sup>及びR<sup>4</sup> は水素、R<sup>5</sup>、OR<sup>5</sup>、-Si(R<sup>5</sup>)」、-OSi (R<sup>a</sup> )」、アリール、アシル及びニトリル基からなる 詳から遺んだ問一でも異なってもよい一価の基である) をもつジオルガノ鍋ピス – β – ジケトネート縮合触媒の 有効量:

- (D)ヒドロキシル官能基用のスカペンジャー化合物約 0.1ないし約1.0部:
- (E) 式:

$$R^{4}$$
, (R<sup>4</sup> O)  $_{i-1}$   $-5i-Z$ 

(式中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>1</sup> はC<sub>1-1</sub> の一個の炭化水素基であ り、tは0ないし3であり、そして2はさらにエーテ アルコキシ末端ジオルガノポリシロキサンは低モジュラ 50 ル、エポキシ、イソシアナト、シアノ、イソシアヌレー

ト、アクリルオキシ及びアシルオキシ基からなる群から 選んだ官能基によって置換された飽和、不飽和又は芳香 族炭化水素基である)をもつポリアルコキシシラン接着 促進剤0ないし約2部:及び

(F) ポリアルコキシシラン架橋剤Oないし約10部: を含有してなる改善された低モジュラス性をもち、低減 された量のスカペンジャーを含む貯蔵安定性の一液型室 温硬化性シリコーン組成物を提供するものである。

[0009]

【発明の詳細な開示】本発明の組成物の成分(A)は重 \* 10

(式中、各R及びR? は独立的に置換又は非置換の C ュ-ュュ の一価炭化水素基であり、R゚ はアルキル基、アル キルエーテル基、アルキルエステル基、アルキルケトン 盖、アルキルシアノ基から選んだC₁-4 の脂肪族有機基 又はCτ-ι3のアラルキル基であり、πは約50ないし約 **2500の範囲の整数であり、そしてaは0又は1の整** 数である)を育する。

【0012】式(I)において、Rは好ましくはCi; 一価炭化水素基、ハロゲン化一価炭化水素基及びシアノ アルキル基から選んだ基であり;RL は好ましくはC ı-∎ アルキル基又はCッ-ュュアラルキル基であり:そして R<sup>2</sup> は好ましくはメチル、フェニル又はピニル基であ る。R、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> はそれぞれメチル基であることが もっとも好ましい。

【0013】成分(A)の重合体中の末端珪素原子は上 記の定義に従って少なくとも2個のアルコキシ基をもた なければならずかつ3個のアルコキシ基を有することが できる。

【0014】式(1)のポリアルコキシ末端オルガノポ リシロキサンは種々の方法で製造し得る。Cooperらの米 国特許第3.542,901号明細書に記載される一方 法はポリアルコキシシランとシラノール末端ポリジオル ガノシロキサンとをアミン触媒の存在下で反応させるこ とからなる。

【0015】(式(Ⅰ)の重合体は好ましくはこゝに参 考文献として引用するChung の米国特許第4. 515. 932号明細書に記載される方法に従って製造される。 Chung の方法によれば、該重合体は25℃で100ない し1、000、000センチポイズの範囲の粘度をも ち、オルガノ基が一面炭化水素基であるシラノール末端 ジオルガノポリシロキサン重合体と式:

\*合体質の各末端に少なくとも2個のアルコキシ基を末端 暑として育し、25℃で約100ないし約1,000. 000センチポイズの粘度、好ましくは25℃で約5. 000ないし約200、000センチポイズの範囲の粘 度をもちかつオルガノ基がCi-iiの一個の炭化水素基で あるジオルガノポリシロキサン重合体である。

8

【0010】成分(A)を構成する基合体は好ましくは 一般式:

[0011]

[化8]

(式中、 $R^1$  ,  $R^2$  及びaは前記定義したとおりであ る)のポリアルコキシシラン架橋剤とを末端カップリン グ触媒の存在下で反応させることによって製造される。

【0016】Chuag の方法に従う式 (I) の重合体の製 造に使用されるシラノール末端重合体は好ましくは式:

[0017]

【化9】

*30* 

(式中、R及びnは前配定義したとおりである)を有す る.

【0018】Chung の方法に従って式 (I) の重合体を 製造するための末端カップリング反応はアルコキシシラ ンと一種又はそれ以上のシラノール末端ジオルガノポリ シロキサンとを、プレンステッド酸、ルイス酸、ステア リン酸で処理された炭酸カルシウム及びアミン及びそれ らの混合物からなる群から選んだ末端カップリング触媒 40 の存在下で、混合することによって行なわれる。アミン は第1級、第2級又は第3級アミンのいずれでもよい。 より塩基性の高いアミンが触媒としてより良好である。 もっとも好ましい触媒は前述した酸の一つであり、もっ とも好ましくはかゝる酸とアミンとの組合せである。末 端カップリング反応の完了後、シラザン(たとえばヘキ) サメチルジシラザン)を添加してアミン塩触媒を不活性 化して貯蔵安定性の重合体を得る。かかる触媒及び末端 カップリング反応についてのより詳細な情報はさきに引 用したChung の米国特許第4、515、932号明細書

50 に記載されている。

【0019】成分(B)は重合体級中の各末端珪素原子 上にたゞ1個のアルコキシ基を有しかつ25℃で約5な いし約95センチポイズ、好ましくは約10ないし約8 0 センチポイズ、もっとも好ましくは約40ないし約6 0 センチポイズの粘度をもち、オルガノ基が C 1-13 の一 価炭化水素基であるポリジオルガノシロキサン重合体で⇒ \*ある。

【0020】モノアルコキシ末端重合体は好ましくは 式:

[0021]【化10】

$$(R^{\frac{1}{2}}O) - \underbrace{SL}_{R^{\frac{1}{2}}}^{R^{\frac{1}{2}}} \underbrace{\begin{pmatrix} R & R^{\frac{1}{2}} & R^{\frac{1}{2}} \\ OSL & OSL & OSL \\ R^{\frac{1}{2}} & R^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix}}_{R^{\frac{1}{2}}} (OR^{\frac{1}{2}})$$

$$(11)$$

(式中、R. R. 及びR: はさきに定義したとおりであ る) を有する。mは約1ないし約40、好ましくは約5 ないし約30、もっとも好ましくは約10ないし約20 の範囲の値である。

【0022】式 (II) の重合体は25℃で約100ない し約1、000、000センチポイズの範囲の粘度をも つシラノール末端ジオル ガノポリシロキサン重合体と 式:

$$(R^{1})$$
,  $(R^{1} O)_{4-1} - S1$ 

(式中、R1 及びR2 はさきに定義したとおりであり、 sは2の整数である)のジアルコキシシランとを末端力 ップリング触媒の存在下で反応させることによって製造 される。

【0023】式(11)の重合体の製造に使用されるシラ ノール末端重合体は式(1)の重合体の製造に使用され るものと何一である。

※【0024】この末端カップリング反応は式(1)の重 合体の製造について前述したと同じ方法で、すなわちア ルコキシシランとシラノール末端ジオルガノポリシロキ サン重合体とを、プレンステッド酸、ルイス酸、ステア リン酸で処理された炭酸カルシウム、及びアミン及びそ れらの混合物からなる群から選んだ末端カップリング触 媒の存在下で、混合することによって行なわれる。

20 【0025】式(11)のモノアルコキシ末端ポリジオル ガノシロキサンは本発明のRTV組成物中に、ポリアル コキシ末端ポリジオルガノシロキサン(A)100部当 り約1ないし約40部、好ましくは約10ないし約30 部、より好ましくは約15ないし約25部の範囲の量で 存在させる。

【0026】成分(C)は一般式:

[0027]

【化11】

$$(R^{\frac{1}{2}})_{1} - S = \begin{bmatrix} 0 - C \\ 0 - C \\ 0 - C \end{bmatrix}$$

$$(III)$$

(式中、R<sup>5</sup> はC<sub>1-18</sub>の一面の炭化水素基及び置換され た一面の炭化水素基から選んだ基であり、そしてR<sup>4</sup>。 R'及びR\*は水素、R\*, OR\*, -Si(R\*) 3. -OSi(R<sup>5</sup>)」、アリール、アシル及び二トリルから なる群から遺んだ同一でも異なってもよい一個の基であ る) のジオルガノ鍋ピスジケトネート縮合触媒である。

【0028】式(III )のR<sup>3</sup> 基の範囲内の基の例はC a-m アリール基及びハロゲン化アリール基にたとえばフ ェニル、トリル、クロルフェニル、ナフチル基;Ci-a 脂肪族、脂環族及びそれらのハロゲン化誘導体基、たと えばシクロヘキシル、シクロプチル基:メチル、エチ

キシル、ヘプチル、オクチル、ピニル、アリル及びトリ 40 フルオルプロピルのようなアルキル及びアルケニル基で ある.

【0029】式([[[ )の範囲内に包含される縞綰合触 媒の若干の例は下記の化合物を包含する。

【0030】ジ(n-プチル)鷽ピス(アセチルアセト ネート);ジ(n-プチル) 鎬ピス(ペンゾイルアセト ネート):ジ(エチル)鍋ピス(ラウロイルアセトネー ト);ジ(メチル)爲ピス(ピパロイルアセトネー ト):ジ(n - オクチル)鍋ピス(アセチルアセトネー ト): ジ(n - プロピル)鍋ピス(1. 1、1 - トリフ ル、プロピル、クロルプロピル、プチル、ペンチル、ヘ 50 ルオルアセチルアセトネート):ジ(n-ブチル)鍋ピ

ス (エチルアセトアセテート):及びジ (n-ブチル) 傷(アセチルアセトネート)(エチルアセトアセテー **h**).

【0031】本発明における使用に好ましい鍋触媒はジ (n-ブチル) 錫ビス (アセチルアセトネート) であ る。

【0032】この触媒の有効量は典型的にはポリアルコ キシ末端ポリジオルガノシロキサン (A) 100部当り 約0.01ないし約2.0部、好ましくは約0.1ない し約1.0部、もっとも好ましくは約0.2ないし約 0. 4部の範囲内である。

【0033】成分(D)はヒドロキシ官能基用のシリコ ーンスカペンジャー化合物である。

【0034】スカペンジャーは当該技術において既知の 任意のスカペンジャーであり得る。本明細書において、 スカペンジャーはRTV組成物中の遊離ヒドロキシ基を 拘束しかつそれと反応しそしてこれらのヒドロキシ基と 結合してそれらが組成物中のアルコキシ基と反応するの を阻止するような官能基をもつ任意の化合物として定義 される。この点で、スカペンジャーは、後に説明するご\*20 物の別の一群は式:

であり得る。 【0035】本発明のRTV組成物中に使用される適当

12

\*とく、アルコキシ基及びスカペンジャー作用を果す基を

含む統合された(integrated)架構剤・スカペンジャー

なスカペンジャー化合物はたとえばこゝに参考文献とし で引用する米国特許第4.895.918号 (Lucas )、同第4. 417. 042号 (Dziark) 、同第4. 467, 063号 (Lockhart)、同第4, 477, 62 5号 (Lockhari)、同第4. 499, 229号 (Lockha 10 rt)、同第4、499、230号 (Lockhart)、同第 4. 395, 526号 (White ら) 及び同第4, 47 2. 551号 (White ら) 明細書に記載されている。

【0036】本発明における使用に適当なスカペンジャ 一はたとえばさきに参考文献として引用した米国特許第 4. 895. 918号明細書 (Lucas ) に記載されるご とき非環式シラノールスカベンジャー及び環式シリル室 素スカペンジャーを包含する。

【0037】本発明のRTV組成物にスカペンジャーと して使用し得るスカペンジャーとしての作用をもつ化合

$$(R^{i} O)_{i-(i+1)} -Si-(X)_{i}$$
 (IV)

(R\*),

(式中、R¹及びR²はさきに定義したとおりであり、 Xはシラジル、環式アミド、アミド、アミノ、カルバマ ト、エノキシ、イミダト、イソシアナト、オキシマト、 チオイソシアナト及びウレイド基からなる群から選んだ 加水分解性の易脱離の基であり、cは0ないし3の整数 であり、fは1ないし4の整数でありかつc+fは1な いし4に等しいものとする)をもつシランである。

【0038】式(IV)の範囲内のスカペンジャーはたと えばさきに引用した米国特許第4、895、918号 (Lucas ) 及び同第4、395、526号 (White ら) 明細書に記載されている。

【0039】同様に、さきに引用した米国特許第4、4 67.063 号明細書 (Lockhart) に記載されるNーシ リル置換イミダゾール、米国特許第4,499,230 号明細書(Lockhari)に記載されるゼオライト、及び米 国特許第4、472、551号明細書 (White ら) に記 載される有機スカペンジャーも本発明における使用に適 40 いスカペンジャーはつぎの群: 当である。 Ж

※【0040】他の適当なスカペンジャーの例はさきに引 用した米国特許第4、499、229号及び同第4、4 77,625号明編書 (Lockbart) に記載される珪素含 有スカベンジャーである。

【0041】これらの珪素含有スカペンジャーは一般 式:

*30* [0 0 4 2]

【化12】

## **≖\$t** − (X) /

(式中、Xはさきに定義したとおりであり、dはOない し4の整数であり、そしてXによって満たされ得る原子 価以外のSiの残留原子価はSi、H、C、O、N、P、 S,周期律表第111a,IVa ,Va、VIa ,VIIa及びVIII族 の選移元素及びそれらの混合物から選んだ原子によって 満たされ得る)を育する。

【0043】本発明のRTV組成物に使用するに好まし

(a)式:

R\*

# (Y) $(R^{10})$ , SI-N-SI $(R^{10})$ , Y

(式中、YはRIº 及び(Rタ ):N-から選ばれ、Rタ は水素、一面炭化水素基及びフルオルアルキル基からなる る群から選んだ一貫であり、そしてRioは水素、一個炭

化水素基及びフルオルアルキル基からなる群から選んだ 一員である)をもつ珪素-窒素化合物;及び

(b)(1)式:

(式中、Rº 及びR'ºは前記の意義を有する)をもつ単 位からなる群から選んだ化学結合構造単位3-100モ ル%及び(2)式:

 $(R^{(0)}) \in SiO(4-\epsilon/2)$ 

(式中、R<sup>10</sup>は前配の意義を有し、そしてcは0ないし 3の整数である)によって表わされる化学結合構造単位。 0-97モル名:を含んでなる珪素-窒素重合体、たゞ し該珪素-室素重合体の珪素原子はSiOSi結合及びSiN R' Si結合から選んだ一員によって相互に連結されてお り、釐素に連結されてシロキシ単位を形成している珪素 原子の原子価及び窒素に連結されてシラジル単位を形成 している珪素原子の原子毎以外の珪素原子の原子価はR ¹º 基及び(R\* )』 N基から選んだ一員に連絡されてお り、かつ該珪素-窒素重合体のRº 基及び(R\*)。 N 基の合計対珪素原子の比は1.5ないし3の値をもつも≠

$$R^{11}$$
; (R<sup>11</sup>O) 3-1 -SI-Z

(式中、R\*\* 及びR\*\* はそれぞれC++ 一価炭化水素基 であり、tは0ないし3でありそして2はさらにエーテ ル、エポキシ、イソシアナト、シアノ、イソシアヌレー ト、アクリルオキシ及びアシルオキシからなる群から置 んだ官能基によって置換され得る飽和、不飽和又は芳香 族炭化水素基である)をもつオルガノ官能性ポリアルコ キシシランを接着促進剤として含有する。

【0048】本発明における使用に適する、上記式 40 【0051】 (V)の範囲内の接着促進剤化合物及びそれらの製造法

\*のとする):から選んだ珪素-窒素化合物である。

【0044】上記式の範囲内でありかつ本発明における 使用に適する珪素-窒素化合物の例はさきに引用した米 国特許第4, 417, 042号明編書 (Dziark) に記載 10 されている。これらの化合物はシラザン及び水素含有ア ミンを包含する。

【0045】本発明における使用に好ましい珪素-宴素 化合物はジシラザン及びポリシラザンである。適当なシ ラザンの例はヘキサメチルシクロトリシラザン、オクタ メチルテトラシラザン、トリメチルトリフェニルシクロ トリシラザン及びトリピニルトリメチルシクロトリシラ ザン等を包含する。本発明における使用にもっとも好ま しいポリシラザンはヘキサメチルシクロ-N-メチルト リシラザンであり、もっとも好ましいジシラザンはヘキ サメチルジシラザンである。

【0046】スカペンジャーは本発明の組成物中にポリ **アルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン(A)100** 部当り約0.1ないし約1.0部、好ましくは約0.2 ないし約0.8部、もっとも好ましくは約0.5ないし 約0. 7部の範囲内の量で存在させる。

【0047】本発明のRTV組成物は随意に(E)一般 式:

はたとえばこゝに参考文献として引用する米国特許第 4, 483, 973号及び阿第4, 528, 353号明 細書(Lucas ら)に記載されている。

**(V)** 

【0049】好ましい接着促進剤はイソシアナト官能性 ポリアルコキシシランである.

【0050】本発明における使用に適当なイソシアナト 官能性ポリアルコキシシランは一般式:

【化13】

$$(R^{11}O)_{1-3} - \frac{R^{11}}{8i} - R^{13} - \frac{C}{N} - G \qquad (71)$$

(式中、GはR川 葛、式:

R11,  $(R^{13}O)_{1-1} - Si - R^{13} -$ 

の基、スチリル基、ピニル基、アリル基、クロルアリル 基及びシクロヘキセニル基から選んだ基であり、Rロは C1-1 の一面の炭化水素基又はシアノアルキル基であ り、R! はCi-a の一面の炭化水素基又はシアノアルキ ル基であり、RISはアルキレンアリーレン芸、アルキレ ン基、及びシクロアルキレン基及びハロゲン化アルキレ ンアリーレン基、アルキレン基及びシクロアルキレン基 から選んだCz-12の二価の炭化水素基でありそしてbは 0ないし3の範囲である)を有し得る。

【0052】かゝる化合物についてのより詳細な情報は こゝに参考文献として引用する米国特許第4、100。 129号 (Beers)、同第3, 821, 218号 (Berg er) 及び同第4、483、973号及び同第4、52 8. 353号 (Lucas ら) 明細書に記載されている。

【0053】式(VI)の範囲内のもっとも好ましい接着 促進剤は1.3.5-トリストリメトキシシリルプロピ 20 ルイソシアヌレートである。この化合物は対応するアル コキシ水素化シランを用い、これを白金触媒の存在下に 不配和イソシアヌレート又はシアヌレートと反応させて **該水業化物をイソシアヌレート核のアリル基のような不\*** 

 $(R^1 \ O)_{4-1} - 31$ 

(R"),

(式中、R¹、R² 及びbはさきに定義したとおりであ る)を有する。

合物はメチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシ シラン、エチルトリメトキシシラン、テトラエトキシシ ラン、及びピニルトリメトキシシランを包含する。メチ ルトリメトキシシランが好ましい。

【0058】架備用ポリアルコキシシランは本発明のR TV組成物中にポリアルコキシ末端ポリジオルガノシロ キサン(A)100部当り約0ないし約10部、好まし くは約0.3ないし約2.0部、もっとも好ましくは約 0. 5ないし約1. 0部の範囲内の量で存在し得る。

【0059】好ましくは、本発明のRTV組成物はさら 40 に(G)充填剤を含有する。たとえば二酸化チタン、珪 酸ジルコニウム、シリカエーロゾル、酸化鉄、珪藻土、 ヒュームドシリカ、カーポンプラック、沈降シリカ、ガ ラス繊維、ポリ塩化ビニル、石英粉末、炭酸カルシウム 等のような種々の充填剤を本発明の組成物中に配合し得 る。本発明の組成物に使用するに好ましい充填剤は補強 用充填剤、もっとも好ましくはヒュームドシリカ充填剤 である.

【0060】充填剤の使用量は意図する用途に従って広

16

\*飽和基上に付加せしめることによって製造することがで きる。 基R! はそれが該化合物の接着促進剤としての括 性を妨害しない限り、非重換でも又は置換されていても よい任意の二面炭化水素基から選択し得る。高度に複雑 な化合物は製造がより困難であり、したがってより高価 であるので望ましくない点に留意すべきである。式 (V 1) の範囲内の他の特定の化合物はつぎのものを包含す る。

【0054】ピスー1、3-トリメトキシシリルプロピ ルイソシアヌレート: 1.3.5-トリストリメトキシ シリルエチルイソシアヌレート:1,3,5-トリスメ チルジメトキシシリルプロピルイソシアヌレート: 1. 3、5-トリスメチルジエトキシシリルプロピルイソシ アヌレート.

【0055】イソシアナト官能性アルコキシシラン接着 促進剤は本発明のRTV組成物中にポリアルコキシ末端 ポリジオルガノシロキサン(A)100部当り約0ない し約2.0部、好ましくは約0.1ないし約1.0部、 もっとも好ましくは約0.3ないし約0.7部の範囲内 の量で存在し得る。

【0056】本発明のRTV組成物はまた随意に(F) 架橋用ポリアルコキシシランを含有し、設ポリアルコキ シシランは好ましくは一般式:

(AII)

としての用途においては、本発明のRTV組成物は充填 剤を配合せずに使用し得る。結合剤の製造用に本発明の 【0057】式(VII)によって表わされる代表的な化 30 RTV組成物を使用する場合のような他の用途において は、ポリアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン (A) 100部当り700部又はそれ以上のような多量 の充填剤を使用することもできる。

【0061】本発明の組成物はまた建設用シーラント及 びコーキングコンパウンドとしても使用し得る。したが って、充填剤の正確な量は組成物が向けられる用途及び 使用される充填剤の種類のような因子によって決まるで あろう。好ましくはポリアルコキシ末端ポリジオルガノ シロキサン (A) 100部当り約5ないし約300部の 充填剤が使用され、鉄充填剤は約40部まで、好ましく は約5ないし約20部の補強用充填剤、たとえばヒュー ムドシリカ充填剤を含み得る。

【0062】シリカ充填剤をオクタメチルシクロテトラ シロキサンのような活性化剤で予備処理することがしば しば有利である。

【0063】好ましくは、本発明のRTV組成物はさら に(H)シアノ官能性ポリアルコキシシランを加工助剤 として含有し、それは充填剤の処理に使用され、それに よって本兇明のRTV組成物に改善された適用速度及び い範囲内で変動し得る。たとえば、ある種のシーラント 50 協変性を付与する。本発明に使用するに適するシアノ官

能性ポリアルコキシシランは一般式 (VIII) : 【0064】 【化14】

$$(R^{\frac{1}{5}}O)_{1-1} - SI - R^{\frac{1}{5}}C = N$$

(式中、各R<sup>3</sup> 及びR<sup>4</sup> は独立的に 1 ないし約 1 8 個の 炭素原子をもつ一価炭化水素基又は置換された一価炭化 水素基であり、R<sup>3</sup> は $C_{2-12}$ の二価の炭化水素基であ 10り、そして 1 は約 0 ないし約 3 の範囲の数である)を有 し得る。

【0065】式 (VIII) の化合物において、R<sup>1</sup> 及びR 水素はアルキル基、たとえばメチル、エチル、プロピル等:アルケニル基、たとえばピニル、アリル等:シクロアルキル基、たとえばシクロヘキシル、シクロヘプチル等、単核アリール基、たとえばメチルフェニル等:及びフルオルアルキル基、たとえばメチルフェニル等:及びフルオルアルキル基、たとえば3,3,3-トリフルオールプロピル基であり得る。好ましくはR<sup>1</sup> 及びR<sup>1</sup> はメチル又はエチル基から選ばれ、もっとも好ましくはとものにメチル基である。R<sup>1</sup> は好ましくは2-12個の炭素原子をもつアルキレン又はアリーレン型の置換又は非置換の二価炭化水素基であり、より好ましくは2-8個の位、炭素原子をもつこれらの基である。

【0066】上記式 (VIII) の範囲内の好ましい特定の 化合物は r - シアノプロピルトリメトキシシランであ る。他の特定の化合物はつぎのものを包含する。

【0067】3-(シアノエトキシ)-3-メチルプテニルトリメトキシシラン:β-シアノエチルトリエトキシシラン;β-シアノエチルトリエトキシシラン;β-シアノエチルメチルジエトキシシラン;3-シアノプロピルトリエトキシシラン;シアノプロピルメチルジメトキシシラン:1-シアノエチルトリス(メトキシエトキシ)シラン。

【0068】式(VIII)の範囲内の化合物の製造法はたとえばこゝに参考文献として引用する米国特許第4、483、973号及び同第4、528、353号明細書(Lucas ら)に記載されている。これらの化合物はオレフィンシアン化物とトリクロル水素化シランとを白金融がの存在下で反応させて所望の中間体を製造し、ついてこの中間体をアルコキシル化して好ましいァーシアノブロピルトリメトキシシランを製造することによって製造し得る。したがって、特定の型の一反応はたとえばシアン化アリルとトリクロルシランとの反応であり得る。この反応においては、クロルシランをアリルシランと反応させるが、これはメトキシ化された中間体を白金融媒を用いる付加反応に使用するとメトキシ基がシアナイド基と反応して所望の生成物の収率を低下してしまうからである。

18

【0069】本発明の組成物に使用される好ましいシアノ官能性ポリアルコキシシランはシアノアルキルトリアルコキシシランであり、もっとも好ましくはシアノエチルトリメトキシシランである。

【0070】シアノ官能性ポリアルコキシシランは本発明の組成物中に、ポリアルコキシ末端ポリジオルガノシロキサン(A) 100部当り約0ないし約5部、好ましくは約0.1ないし約1.0部、もっとも好ましくは約0.3ないし約0、7部の範囲内の量で使用し得る。

【0071】本発明の組成物はさらに(1)25℃で1 0ないし5000センチポイズの粘度をもち、オルガノ 基が好ましくは1ないし8個の炭素原子をもつ一価炭化 水煮基であるトリオルガノシリル末端ジオルガノポリシロキサンを含有し得る。かゝる線状ジオルガノポリシロ キサン重合体は可塑剤として有用である。好ましくは、 かゝる可塑剤はシラノール基を含有しないが、通常は約 500ppm までのシラノール基が存在する。また、オル ガノ電換基がメチル基でありかつ粘度が25℃で10ないし1000センチポイズの範囲であることが好ましい。

【0072】前記した可塑剤の代りに又はそれに加えて、本発明のRTV組成物中に高度の官能性をもつ単位、すなわち三官能性単位、四官能性単位又は三官能性及び四官能性単位の混合物、を含む液状シロキサン("MDT" シリコーン油) 1ないし20部を含有することが望ましい。一般に、から可塑剤は(i)モノアルキルシロキシ単位、シロキシ単位又はそれらの混合物25ないし60モル%、(ii)トリアルキルシロキシ単位1ないし6モル%及び(iii)ジアルキルシロキシ単位1ないし6モル%及び(iii)ジアルキルシロキシ単位34ないし74モル%を含有してなりかつ該可塑剤液体は珪素に結合されたヒドロキシル単位約0.1ないし約2重量%を含有する。

【0073】その他の化合物、たとえば白金のような離 燃化剤も本発明の組成物中に含有せしめ得る。

【0074】本発明のRTV組成物は当該技術において 既知の方法によって製造し得る。たとえば、該組成物は すべての所要成分を同時に混和することによって製造し 得る。好ましくは、本発明の組成物はポリアルコキシ末 潮重合体、シアノ官能性ポリアルコキシシラン及び充填 剤の混合物を精確に配合し、その後に架橋剤、鋳触媒、 安定化剤/スカペンジャー、接着促進剤及びその他の成 分、たとえば可塑剤を別々に又は一緒に添加し、ついて 混合物を無水の条件下で十分に混和することによって製 造される。

【0075】本発明のRTV組成物は種々の支持体、特に組積造支持体(masonry substrates)上に被覆され得る。適当な支持体の例はアルミニウム、ガラス、ポリアクリレート、ポリカーポネート、ポリ塩化ビニル及びコンクリートを包含する。

50 [0076]

【実施例の記載】つぎに本発明を実施例によってさらに 説明するが、これらの実施例は単に例証のためのもの。 で、何等本発明を限定するためのものではない。宴施例 中、すべての部は重量による。

実施例1

\* 末端置機ポリジメチルシリコーン重合体を、加熱マン トル、機械的撹拌機及び窒素パージを備えた容量51の 樹脂製反応器中でつぎの成分を混合することによって製 造した。

20

[0077]

粘度 (25℃)

25℃で110、000センチポイズの粘度をもつ

100萬量部

セドロキン を用ポージ メチルンロ チャン 着きる

ジブチルアミン

メチルトリメトキシシラン

館館

この混合物を80℃まで加熱しそして30分間混合し た。ついでヘキサメチルジシラザン(0.5重量館)を 添加した。ついで得られる混合物を80℃で30分間混 合した。撹拌機を停止しそして反応混合物を室温まで放 冷した。得られるシリコーン重合体はSizyFTNMR分 折によりCHi (CHi O): Si基で未機置換されてい ることが認められた。この末端置換重合体は25℃で1 3 0. 0 0 0 センチポイズの最終 室温粘度を有してい た。

#### 実施例2

低モジュラス添加剤としてのジメチルメトキシ末端ジ メチルポリシロキサンをつぎのごとく製造した。まず撹 拌機及びHCI放出用出口を備えた容量 5 1 の樹脂製反応 器中でジメチルジクロルシラン100重量部をアセトン 26重量部及び水10重量部からなる混合物と反応させ た。

【0078】すなわち、ジメチルジクロルシランを強し く提拌しつつ、アセトン/水混合物をゆっくり添加し た。この添加の間に反応温度は低下するが、5℃以下に た。アセトン/水混合物の添加完了後、反応混合物を4 0−50℃の温度で30分間提幹した。この反応混合物 を100-125℃で、20-30mHgで真空ストリッ ピングして低分子量ジメチルクロル末端ジメチルシリコ ーン油を得た。

【0079】上記ジメチルクロル末端ジメチルシリコー ン油100重量部に、絶えず提拌しつつかつバッチ温度 を40℃以下に保持しつつ、メタノール47重量部をゆ っくり添加した。40℃又はそれ以下で↓時間攪拌した。 のパッチをついで30-40mHgで80℃まで真空スト リッピングした。NaHCO」1重量部及びノライト (Norite)FQAを添加してこのパッチを中和しかつ脱 色した。ついでパッチを50℃以下に冷却しそして濾過。 して低分子量ジメチルメトキシ末端ジメチルシリコーン 油を得た。このシリコーン油はつ ぎの性質を有してい た。

[0080]

性質

透明性

無色透明

2. 0 0.10 \*

0.05 \*

ガードナー色相 最大 1

最大 0.4% シラノール含量 塩素含量 最大 0.008%

メトキシ含量 5.5-8.0%

5-11 センチストークス 屈折率、20℃ 1. 3990-1. 402

下配の実施例では、そこで製造された組成物を硬化時及 び未硬化時のASTM物理的性質、促進貯蔵安定性及び 低モジュラス性(ISO 8339-1984E及び8 20 340-1984Eによって) について試験した。AS TM物理的性質は72℃及び50%相対湿度の条件で7 日間硬化後に測定した。促進貯蔵老化試験後のASTM 物理性は未硬化シーラントを100℃で24時間加熱 し、ついで標準条件下で7日間硬化した後に測定した。 ISO低モジュラス性は標準条件下で28日間硬化し、 ついで標準条件下で4日間水浸漬し、続いて24時間乾 頃した後に測定した。

#### 実施例3

実施例3は容量1ガロンのペーカー・パーキンス型チ 低下しないように制御した。HCIが連続的に放出され 30 ェンジカンミキサーを用いる本発明の組成物の回分式製 造を説明するものである。

【0081】実施例1で製造された重合体1000gを 上記ミキサーに装入し、ついでシアノエチルトリメトキ シシラン10gを装入した。このパッチをゆっくりした 速度で10分間混合した。このパッチにD。で処理した ヒュームドシリカ330gを3等分して添加した。この バッチをヒュームドシリカの各添加の間に15分間ずつ。 混合した。ヒュームドシリカの最後の部分を添加した後 にこのパッチを30分間混合した。実施例1で製造され 後、液钼を分離した、下相はシリコーン油であった。こ 40 た重合体1000gをこのミキサーに装入しそして得ら れる混合物を15分間混合した。これに実施例2で製造 された低モジュラス添加剤400g及び"MDT"シリ コーン油200gを添加しそして得られる混合物を30 分間提幹した。ついでこのパッチを60mm/gで10分間 脱気してRTV組成物基剤を得た。

> 【0082】ついで、つぎの成分をこのRTV基剤24 00gと配合するためにセムコ・キャタライザー (Semc o Catalyzer )を使用した。

[0083]

*50* 

(12)

特開平4-300964

2122メチルトリメトキシシラン2 4 gグリシドキシプロピルトリメトキシシラン7. 2 gヘキサメチルジシラザン1 2 gトリスートリメトキシシリルプロピルーイソシアヌレート1 2 gBu: Sn (AcAc):7. 2 g

#### 試験結果を表1に示す。

## 実施例4

実施例2で製造された低モジュラス添加剤を使用せず でに実施例3の方法を反復した。実施例4においては、2 実 5 で 1 0 0 センチポイズの粘度をもつトリメチル未端 10 ジメチルシリコーン油400gを使用した。試験結果を 後 1 に示す。

## 実施例 5

ヒュームドシリカの代りにステアリン酸で処理された 炭酸カルシウム充填剤1200gを使用したことを除い て実施例3の方法を反復した。試験結果を表1に示す。

## 実施例6

低モジュラス添加剤を使用せずに実施例5の方法を反 復した。試験結果を表1に示す。

## 【表1】

23

# **R** 1

# 物理的性質:実施例3-6

性質	実施例3	实施例4	実施例 5	実施例6
比 重	1. 010	1.030	1.40	1. 40
適用速度、g/分	110	120	165	175
ポーイングフロー値、インチ	0. 05	0.05	4.10	0.10
不贴着時間、分	20	2 6	2 0	2 8
ASTMシートの物理性				
(7日間硬化後)				
ショアA	15	17	11	2 2
引張強さ、川	180	210	1 8 5	195
伸び、%	635	4 0 5	8 8 5	510
伸び率150%における	31 .	61	3 5	5 9
引張強さ(13)、pri				
促進老化後の物理性				
(7日階硬化後)				
ショアA	1 5	17	10	2 2
引張強さ、アロ	175	215	190	186
伸び、%	690	400		500
LSOガラス試験				
仲び平100%における	<b>2</b> 1	41	2 8	5 1
T3. psi				
伸び、%	410	145	490	2 0 5
ISOアルミニウム試験				
伸び率100%における	2 1	4.5	2.4	41
TS. pri				
伸び、%	400	150	510	275
ISOコンクリート試験				
伸び率100%における	1 \$	41	23	14
TS, psi				
伸び、%	475	1 2 5	535	290

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

**OTHER:** \_\_\_\_\_